

Interfacial Nano Electrochemistry Forum 2020 Web

界面ナノ電子化学研究会フォーラム 2020 Web

若手技術者ポスターセッション  
～経営者・先輩に学ぶWebフォーラム～

半導体を中心とする電子デバイスのプロセス技術において、材料表面を清浄化・改質する技術はデバイス界面の信頼性に対して極めて重要である。また、ウェットプロセスを用いた新規なエッチングや薄膜を形成する技術は、デバイスの微細化・三次元化のひとつのテクノロジードライバである。本研究会は界面ナノ現象を明らかにすることでウェットプロセスに関する学問を構築し、次世代へと教育できる環境を整えている。同時に本研究会成果物の実行者である若手の主体性が極めて重要であることから、若手の主体性強化を目的としたポスター発表展を2015年より企画している。

若手技術者とベテラン技術者との活発な議論を期待して、オンライン上にて、招待講演とポスターセッションの2部構成で開催する。

主催：公益社団法人 応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会 (INE)

協賛：一般社団法人 日本半導体製造装置協会 (SEAJ)

日 時

2020年 11月 20日(金) 13:00～17:00

会 場

オンライン (Zoom)

※事前登録後、接続先をご案内致します。Zoomブレイクアウトルーム機能を使用します。

申込方法

URL : <https://forms.gle/xePCeo5h2SaLEPM57>

※URLもしくはQRコードより、アンケートにご回答する形でお申し込みをお願い致します。

参加費

無料 ※参加登録要

申込締切

2020年11月19日(木) 15:00



◆ 招待講演 ◆

株式会社FLOSFIA 代表取締役社長 人羅 俊実 氏

若手技術者への「アンチ技術」の勧め ～アウトプット思考・社会実装思考～

<実行委員>

吉水康人 (キオクシア)

矢野大作 (オルガノ)

吉田勇喜 (関東化学)

荒木浩之 (SCREENセミコンダクターソリューションズ)

佐藤雅伸 (SCREENセミコンダクターソリューションズ)

永淵琢也 (日本インテグリス) (takuya.nagafuchi@entegris.com)

蔦野恭平 (オルガノ)

國本文智 (東北技術)

## プログラム

- 13:00～ 開会挨拶  
 13:10～ 招待講演  
     若手技術者への「アンチ技術」の勧め  
     ～アウトプット思考・社会実装思考～  
 14:20～ ポスターセッション：ライトニングトーク  
 15:30～ ポスターセッション：ディスカッション  
 16:40～ 表彰式・閉会挨拶

委員長：富田 寛 (キオクシア)  
 副委員長：岩元 勇人 (ソニーセミコンダクタソリューションズ)  
 総務責任者：吉水 康人 (キオクシア)  
 企画：蔦野 恭平 (オルガノ)

## ポスターセッション

タイトル 発表者 所属 (五十音順)

|    |  |        |                            |
|----|--|--------|----------------------------|
| 1  | 超音波振動体型洗浄装置の基礎特性とポリエステレンラテックス粒子の除去率の関係性  | 高木 羅以  | 愛知工業大学                     |
| 2  | 超高压スプレー洗浄の多因子解析による帯電メカニズムの考察   | 瀬川 大司  | 旭サナック株式会社                  |
| 3  | 化学エッチングを利用した燃料電池用ナノカーボン触媒の単一レベル活性可視化法の開発   | 小笠原 歩見 | 大阪大学                       |
| 4  | エバネッセント光場内におけるナノスケール超音波洗浄現象の観察   | 森 稜太郎  | 九州工業大学                     |
| 5  | 超純水の微粒子管理値適正化に向けたシリコンウエハへの微粒子付着挙動の解明   | 杉田 航   | 栗田工業株式会社                   |
| 6  | 円柱およびロール型PVAブラシの表面との相互作用～表面近傍におけるブラシの存在割合～   | 保坂 篤紀  | 静岡大学                       |
| 7  | PVAローラータイプブラシの変形及び液体吸排挙動観察   | 宮木 翼   | 静岡大学                       |
| 8  | ウェット処理によるCu recess技術   | 秋山 勝哉  | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ |
| 9  | 表面改質を利用した乾燥技術  | 山口 佑   | 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ |
| 10 | InGaAs表面におけるWETプロセスを用いた原子層エッチングの反応メカニズム  | 平野 智暉  | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社     |
| 11 | フッ硝酸を用いたSiエッチングにおけるソーマーク段差平坦化メカニズムの解明 (2)  | 深谷 天   | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社     |
| 12 | 新規クリーナーによる優れたウェハ清浄性の発現メカニズムに関する考察  | 三木 翼   | 株式会社ダイセル                   |
| 13 | Wet Etching Inside Advanced High Aspect Ratio Structures: Impact of Dissolved Oxygen | 坂崎 哲也  | 東京エレクトロン九州株式会社             |
| 14 | Cu-CMP洗浄後におけるCu表面状態の評価   | 草野 智博  | 三菱ケミカル株式会社                 |